ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЧ-ИСТОЧНИКОВ ИОНОВ

В.И.Возный¹, В.И. Мирошниченко¹, С.Н.Мордик¹, В.Е.Сторижко¹, Д.П.Шульга¹, Б.Сулкио-Клефф²

¹⁾ Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы, Украина, vozny@ipflab.sumy.ua ²⁾Institute of Nuclear Physics, University of Münster, Münster, Germany

Разработана экспериментальная установка, позволяющая производить экспрессные измерения полного тока, профиля, массового состава и эмиттанса пучка ВЧ-источников ионов. Реализован индуктивный ВЧ-разряд с внешним магнитным полем (~60 Гс) при 80 Вт вводимой в плазму ВЧ-мощности ($f_{Bq}=27.12$ МГц). Плотность ионного тока составляла величину 20 мА/см² при диаметре эмиссионного отверстия 0.6 мм. Для реализации режимов работы ВЧ-источника с плотностью плазмы на уровне 6·10¹¹см⁻³ разработана и изготовлена компактная магнитная система с постоянными магнитами (NdFeB) и ферритами кольцевой формы. Реализованы высокояркостные режимы ВЧ-источника аргонового пучка $B_n = 5 \cdot 10^{12}$ A m⁻² rad⁻².

введение

Для повышения разрешающей способности сканирующего ядерного микрозонда (ЯМЗ) следует использовать источники ионов с наибольшей яркостью. ВЧ-источник ионов является одним из наиболее перспективных для использования в ЯМЗ. Данный тип источника ионов имеет целый ряд дос тоинств: значительный срок службы (более 1000 часов), ста бильность ионно-оптических параметров, высокую степень ио низации газа, компактность, достаточно большой ионный ток (1...100 мкА) и высокую яркость ($B_n \sim 10^9 - 2 \cdot 10^{10} \text{ Ам}^{-2} \text{ рад}^{-2}$).

Теоретический предел яркости плазменных ионных источников при известных T_e, T_i и n_i приводится в работе [1]:

$$B_n = \frac{I}{(\pi \varepsilon_n)^2} = A n_i \frac{\sqrt{T_e}}{T_i}, \quad (1)$$

где B_n - нормализованная яркость плазменного источника ионов, n_i – плотность плазмы; T_e – температура электронов, T_i – температура ионов, А - нормировочный коэффициент.

Таким образом, высокояркостные плазменные ионные источники должны иметь плазму с высокой ионной плотностью и высокой электронной темпера турой. В то же время ионная температура должна быть низкой, чтобы получать ионные пучки с малым разбросом по импульсу, и малым эмиттансом.

ВЧ-источники ионов, работающие в Е – режиме (емкостной ВЧ-разряд) имеют плотность плазмы n ~ $10^9...10^{10}$ см⁻³, в Н – режиме (индуктивный ВЧ-разряд) - плотность n ~ 10^{11} см⁻³. Для сравнения ВЧ-источники плазмы с магнитным полем, работающие в W – режиме (индуктивный ВЧ-разряд с магнитным полем), имеют плотность плазмы n~ $10^{12}...5 \cdot 10^{13}$ см⁻³ [2-4].

Теоретический предел яркости аргонового пучка при плотности плазмы n $\sim 10^{13}$ см⁻³, температурах электронов $T_e{\sim}5$ эВ и ионов $T_i{\sim}0.1$ эВ будет равен $B_n{\sim}0.8\,10^{14}$ Ам⁻² рад⁻²[5].

Данная величина яркости может быть сравнима с величиной яркости жидкометаллических источников ионов $B_n \sim 10^{14} \text{ Am}^{-2} \text{ pag}^{-2}$ [6].

Для исследования различных режимов ВЧисточников с целью повышения яркости возникает необходимость в создании специализированной установки. В ИПФ НАН Украины разработана и изготовлена экспериментальная установка, позволяющая производить экспрессные измерения тока, профиля тока, массового состава пучка и эмиттанса пучка ионов, извлекаемого из ВЧисточника. В данной работе приведено описание установки и представлены некоторые результаты измерений основных параметров ВЧ-источника ионов.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Установка тестирования ВЧ-источников ионов (рис.1) состоит из следующих основных частей и систем:

- ВЧ-источник ионов: газоразрядная колба (1), вытягивающий (3) и фокусирующий (4) электроды;
- высоковольтные блоки питания (5) на 3.0 кВ и 20 кВ;
- система напуска газа (6);
- ВЧ-система: генератор синусоидальных колебаний (8) с частотой 27.12 МГц и мощностью 50 Вт, ВЧ-усилитель (25) с выходной мощностью до 800 Вт, измеритель прямой и отраженной мощности (10), система согласования (9), ВЧ-антенна (7);
- диагностические вакуумные камеры (12, 13); вакуумная система: турбомолекулярный (15), диффузионный (16) и форвакуумные насосы;
- масс- сепаратор: фильтр Вина (14);
- система диагностики пучка: объектная диафрагма(17), цилиндры Фарадея (18,22);
- эмиттансометр (19-21);
- система сбора и обработки данных (23,24).



Рис. 1. Схема экспериментальной установки

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА НАПУСКА ГАЗА

Диагностические вакуумные камеры (12,13) установлены на горизонтальной металлической подставке и соединены между собой ионопроводом. Ионный источник присоединяется к диагностической камере (13).имеющей размеры 200×200×200 мм. Камера откачивается турбомолекулярным насосом (Leybold-350, скорость откачки 350 л/с), работающем в паре с ротационным насосом. Предельный вакуум в камере - около 5[.]10⁻⁶ Торр. В камере производится визуализация пучка на кварцевую пластину и измеряется полный ток пучка с помощью цилиндра Фарадея (18) на расстоянии 140 мм от системы вытягивания источника.

Диагностическая камера (12), в которой производится измерение профиля и эмиттанса пучка откачивается диффузионным насосом (Varian, скорость откачки 900 л/сек), обеспечивающим предельный вакуум порядка 3·10⁻⁶ Торр. Предварительный вакуум в камере создается форвакуумным насосом.

Система напуска газа (6) в ионный источник состоит из трех баллонов с рабочим газом (водород, гелий, аргон), соединенных с общей газовой емкостью. Скорость напуска газа регулируется в широких пределах (0.1...50 атм см³/ч) с помощью системы напуска газа CHA-2 («Selmi»).

ВЧ-СИСТЕМА

В традиционных индуктивных ВЧ-источниках ионов для создания разряда обычно используется ВЧ-генератор с самовозбуждением (автогенератор). При этом антенна источника является элементом LC-контура генератора и определяет частоту генерации, которая выбирается в пределах 10-100 МГц. При изменении мощности генератора изменяются параметры разряда. Так как разряд индуктивно связан с антенной, то изменяется и частота генерации. При измерениях уровня вводимой в разряд мощности необходимо, чтобы частота не зависела от уровня ВЧ-мощности. Это реализуется в ВЧ-системе, широко применяемой в ВЧ-плазменных технологических экспериментах, когда работа введется на разрешенной и стабильной частоте (13.56 или 27.12 МГц).



Рис.2 Блок схема ВЧ-системы

ВЧ-система (рис.2) состоит из генератора (8) синусоидальных колебаний частотой 27.12 МГц с регулируемой мощностью до 40 Вт. Генератор соединен с усилителем мощности (25) «Асот-1000», обеспечивающим выходную мощность до 800 Вт в непрерывном режиме. Система согласования (9) позволяет согласовывать выходное сопротивление усилителя (50 Ом) с очень малым (порядка 1...4 Ом) активным сопротивлением антенны. Система согласования (рис.) представляет собой π -схему и состо-

ит из нагрузочного конденсатора (С1) и настроечного конденсатора (С2). Переменная емкость С1 состоит из двух воздушных конденсаторов (5 кВ), соединенных параллельно, с общей максимальной емкостью 1000 пФ, а переменная емкость С2 - это два вакуумных 5 кВ конденсатора, соединенные параллельно, с общей максимальной емкостью 500 пФ. Так как антенна источника ионов может находиться под высоким напряжением вытягивания порядка 3 кВ, то необходимо обеспечить гальваническую развязку между антенной и усилителем. Для этого используется ВЧ-трансформатор с изоляцией между обмотками на напряжение до 10 кВ. Трансформатор представляет собой 50 Ом коаксиальный кабель (10 мм в диаметре и длиной около 70 см), оплетка которого используется как первичная обмотка, а внутренняя жила - как вторичная.

Конденсаторы и трансформатор системы согласования расположены внутри металлического бокса (300х250х250) с алюминиевыми стенками для экранирования от ВЧ-излучения.

Измеритель прямой и отраженной мощности включен между усилителем мощности и системой согласования. Вращением ручек конденсаторов С1 и С2 добиваются согласования сопротивлений, когда уровень отраженной от антенны мощности (реактивной) близок к нулю. В этом случае сопротивление нагрузки активно и прямая мощность является мощностью, вводимой в разряд.

МАСС-СЕПАРАТОР

Измерение массового состава пучка ионов осуществляется с помощью фильтра Вина (ExB анализатор). Фильтр Вина выполняет две основные функции: масс-сепарация и фильтрация по энергии.



Рис. 3 Сигнал с эмиттансометра ВЧ-источник ионов

На установке была выполнена серия экспериментов по измерению параметров ВЧ- источника ионов ЭСУ. Общий вид источника показан на рис.4. Система вытягивания имеет следующие размеры: длина канала катода - 3 мм, диаметр канала – 0.6 мм. Разрядная колба изготовлена из стекла "Duran" и имеет наружный диаметр 30 мм и длину 260 мм. Длина колбы увеличена для возможности реализации геликонового разряда в сильном внешнем магнитном поле. Рабочие газы - аргон, гелий, водород. В источФильтр Вина установлен между двумя диагностическими камерами. Разрешающая способность данного устройства имеет величину М_i/ΔМ =100. Данный прибор является классическим фильтром Вина с параллельными полюсами электромагнита. Расстояние между полюсами магнита равно 8 мм, между пластинами конденсатора - 3 мм. Эффективная длина электрического и магнитного поля – 100 мм.

ЭМИТТАНСОМЕТР

Эмиттансометр состоит из металлической пластины, размером 50х30х0.5мм, и подвижного вертикального проволочного зонда. Пластина из нержавеющей стали имеет ряд горизонтальных отверстий диаметром 1 мм с расстояниями 2 мм между ними. Диаметр проволочного вольфрамового зонда равен 0.1мм. Расстояние между пластиной и зондом -140мм. Зонд перемещается поперек пучка с определенной стабильной скоростью посредством управляемого электрического двигателя. Пластина с отверстиями может выводиться из зоны измерений, что позволяет производить измерения профиля тока пучка. Расстояние от ионного источника до зонда равно1000 мм. Ток пучка в этой области измеряется цилиндром Фарадея (22). Сигнал с проволочного зонда (детектора) поступает на усилитель постоянного тока (У5-11). АЦП преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой. Преобразованный сигнал поступает на персональный компьютер, где обрабатывается с помощью программ сбора и обработки данных. На рис.3 представлен сигнал с эмиттансометра для одного из режимом работы источника (газ - аргон, ВЧ-мощность – 20 Вт).



Рис. 4 ВЧ-источник ионов

нике использовалась винтовая антенна из 4 витков (медный провод диаметром 4 мм).

Экспериментальные исследования ВЧ-источника ионов

В ВЧ-источнике ионов реализован индуктивный ВЧ-разряд с внешним магнитным полем (~60 Гс), с плотностью аргоновой плазмы $6 \cdot 10^{11}$ см⁻³ при 80 Вт вводимой в плазму ВЧ-мощности (f_{Bq} =27.12 МГц). Разработана и изготовлена компактная магнитная система с постоянными магнитами (NdFeB) и ферритами (600HH) кольцевой формы, позволяющая

создавать по всей длине ВЧ-антенны магнитное поле $B_z \sim 60$ Гс. Величина магнитного поля в разрядной камере ВЧ-источника определяется позиционированием магнитной системы относительно ВЧ-антенны. Плотность плазмы оценивалась по формуле для величины эмиссионного тока. Плотность тока пучка аргона составляла величину 20 мА/см². Нормализованная яркость пучка для данного оптимизированного режима работы источника ионов составляла величину $B_n=5\cdot 10^{12}$ A m⁻² rad⁻².



Рис.5. Профиль тока пучка ионов водорода



Рис. 6. Массовый состав водородного пучка

На рис.5 представлен профиль тока пучка водорода, измеренный профилометром на расстоянии 1 м от эмиссионного отверстия источника при размере апертуры (17) 1 мм для 80 Вт вводимой в плазму ВЧ-мощности. Напряжение вытягивания равно 0.5 кВ, фокусирования – 14 кВ. По профилю тока пучка оценочная величина половинного угла расхождения составляла 1.6 мрад, что свидетельствует о достаточно высокой степени параксиальности пучка. Массовый спектр водородного пучка показан на рис.6.

выводы

Разработана и изготовлена экспериментальная установка, позволяющая производить экспрессные измерения полного тока, профиля, массового состава и эмиттанса пучка ВЧ-источника ионов. Проведено тестирование ВЧ-источника ионов (рабочий газ-водород, аргон) в режимах с магнитным и без магнитного поля при уровне вводимой в плазму ВЧ-мощности 80 Вт (f_{Bq} =27.12 МГц). Реализованы высокояркостные режимы ВЧ-источника аргонового пучка $B_n = 5 \cdot 10^{12}$ A m⁻² rad⁻² с плотностью ионного тока 20 мА/см² при диаметре эмиссионного отверстия 0.6 мм.

Работа выполнена при частичной поддержке Министерства образования и науки Украины (проект N2M71-2001) и BMBF (Германия), проект UKR 00/003.

ЛИТЕРАТУРА

- A. van Steenbergen// IEEE Trans. Nucl. Sci. 1965, p.745.
- R.W. Boswell, R.K. Porteous // Apll. Phys. Lett. 1987, vol.50, p.1130.
- F.F. Chen, I.D. Sudit, M. Light // Plasma Sources Sci. Technol. 1996, No.5 p.173.
- 4. K.P.Shamrai and V.B. Taranov // Plasma Phys. Control. Fusion 1994, vol.36, p.1717.
- V.I. Miroshnichenko, S.M. Mordyk, V.V. Olshansky, K.N. Stepanov, V.E. Storizhko, B.Sulkio-Cleff and V. Voznyy // Nucl. Instr. And Meth. B201 (2003), p.630.
- J. Swanson // Nucl. Instr. And Meth. 1983, vol.218, p.347.